

# HDP-CVD 超厚膜SiO<sub>2</sub>

PEGASUS HDP-CVDは、30μmの超厚膜SiO<sub>2</sub>の成膜に対し、1回の処理で高い膜密度と低ストレスの膜が可能です。

装置：PEGASUS (HDP-CVD)

サイズ：φ12inch、□300mm

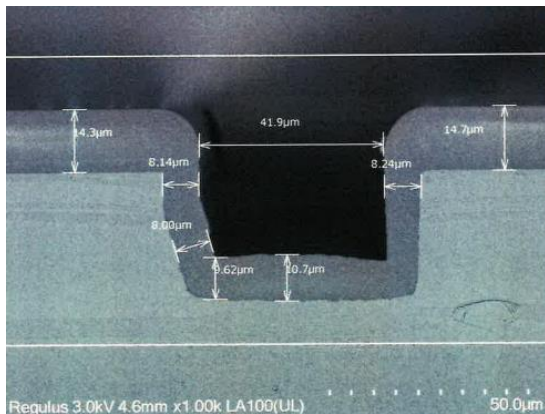
基板：Si、Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>、Glass



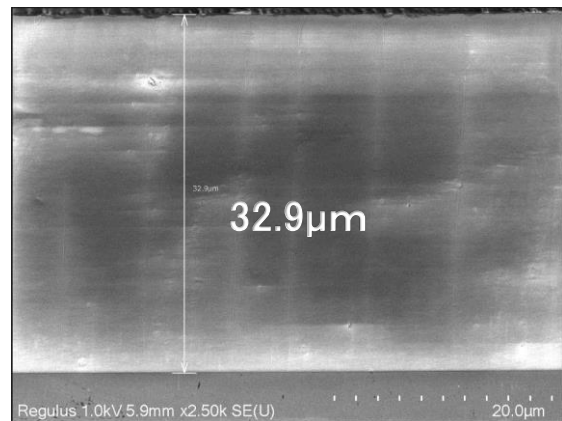
## 特性

膜厚	膜密度	応力	屈折率
~50μm	2.2g/cm <sup>3</sup>	0~100MPa	1.46-1.50

幅:50μm、深さ:34μm カバレッジ性



低ストレス：30μm



## 用途

- ・パッケージ (チップレット、3D-IC)
- ・プリンター (ヘッド保護膜)
- ・抵抗器 (電極保護膜)